

早期公開・登録および遅延公開を めぐる東アジア各国の諸問題

A11

- ◆ はじめに
- ◆ 各国の特許制度
- ◆ 早期公開特許の実態
- ◆ 早期登録特許の実態
- ◆ 遅延公開特許の実態
- ◆ まとめ

2011/10/27 アジア特許情報研究会
○吉居未来、中西昌弘、伊藤徹男

はじめに

日本では早期公開制度の導入により、出願日から18ヶ月経過する前に公開公報が発行されたり、早期に審査が行なわれ、公開公報発行前に登録公報が発行されたりするケースが増えている。

この傾向は韓国や台湾においても同様にみられ、中国では早期審査制度こそないが、早期審査を希望する場合には早期公開制度を利用して審査の促進を図ることができるとされている。

しかし、早期公開制度の導入以前から、18ヶ月経過前に公開されるものがあり、その実態は、これまでの文献でも明らかにされていない。

また、出願から4年以上経ってから公開される案件もある。「分割出願」がある場合には、そのようなケースも考えられるが、その実態はやはり定かではない。

そこで、中国、台湾、韓国のこれら早期公開、早期登録および遅延公開の実態について検証した結果を報告する。

各国特許制度の比較

	中国	韓国	台湾	日本
公開制度	優先日から18ヶ月後に公開			
早期公開	あり (1985年)	あり (1994年)	あり (2003年)	あり (グリーン出願)
早期審査 (優先審査)	なし 早期公開により 早期に審査着手	あり (2009年) 超高速審査(グ リーン技術)	あり (2001年)	あり
遅延審査 (審査猶予)	なし	あり (2008年)	なし	なし

中国特許情報に関する改正の概要

1985年中国専利法制定

- ・早期公開(第34条2項) SIPOは初歩審査の後、拒絶するものを除き直ちに出版願公開する。

1993年(第1次改正)

- ・保護期間の延長 特許:15年⇒20年 実案8年⇒10年
- ・権利付与前の異議申し立て⇒権利付与後の異議申し立て

1994年

- ・特許協力条約(PCT)締結

2001年(第2次改正)

- ・WTOに加盟

2009年(第3次改正)

- ・公知・公用による新規性喪失
- ・二重出版願制度の修正

早期審査制度は無く、早期公開を申請することによって優先的に審査してもらうことが可能

台湾特許情報に関する改正の概要

2001年

- ・国内優先権の導入
- ・公開制度開始(2002年10月以降出願) 2003/7～公開公報発行
- ・優先審査:公開後、発明を実施する場合には申請できる。
- ・特許権存続期間:15年⇒20年

2004年

- ・公報番号の表記変更
- ・異議申立制度の廃止
- ・実用新案の無審査登録制度への移行

2010年

- ・権利喪失後の権利回復規定新設
- ・加速審査制度
 - 1)外国対応出願が特許査定を受けた場合
 - 2)JPO,USPTO,EPOからオフィスアクションを受けた場合
 - 3)出願人による商業上の実施行為

韓国特許情報に関する改正の概要

1994年

- ・特許権の存続期間が15年⇒20年に。(1986年に12年⇒15年)
- ・早期公開制度

1998年

- ・二重出願制度

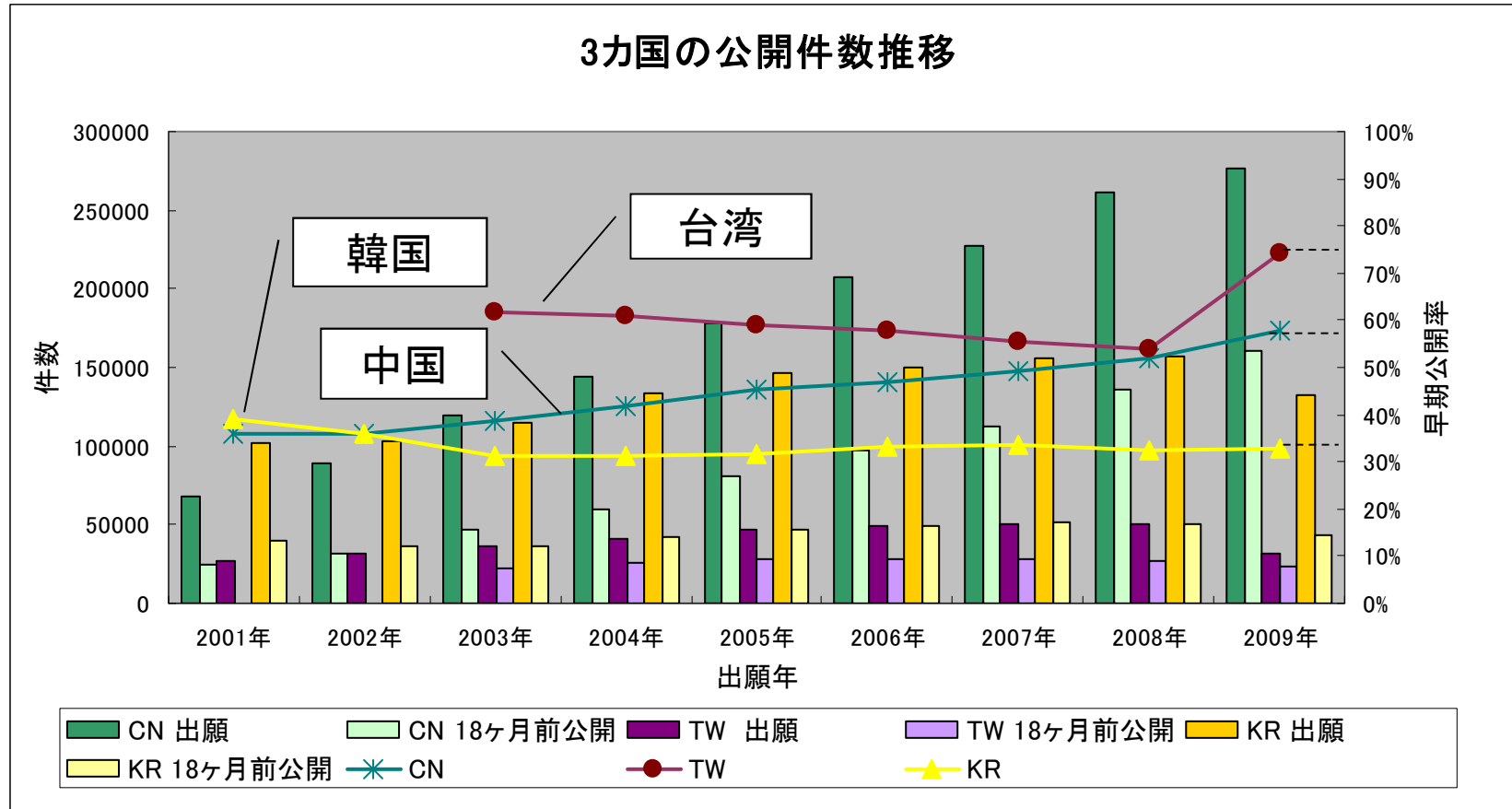
2006年

- ・審査開始日の促進: 審査請求日から10ヶ月以内に審査開始
- ・二重出願制度の廃止 ⇒ 実案から特許への変更出願が可能に
- ・日韓特許審査ハイウェイにより簡易な手続きで優先審査が可能に。

2009年

- ・優先審査制度(審査請求順に関係なく他の特許出願に優先して審査)
- ・超高速審査(グリーン技術と直接関連した出願)
優先審査より更に速い優先審査決定書発送日から14日以内に審査に着手

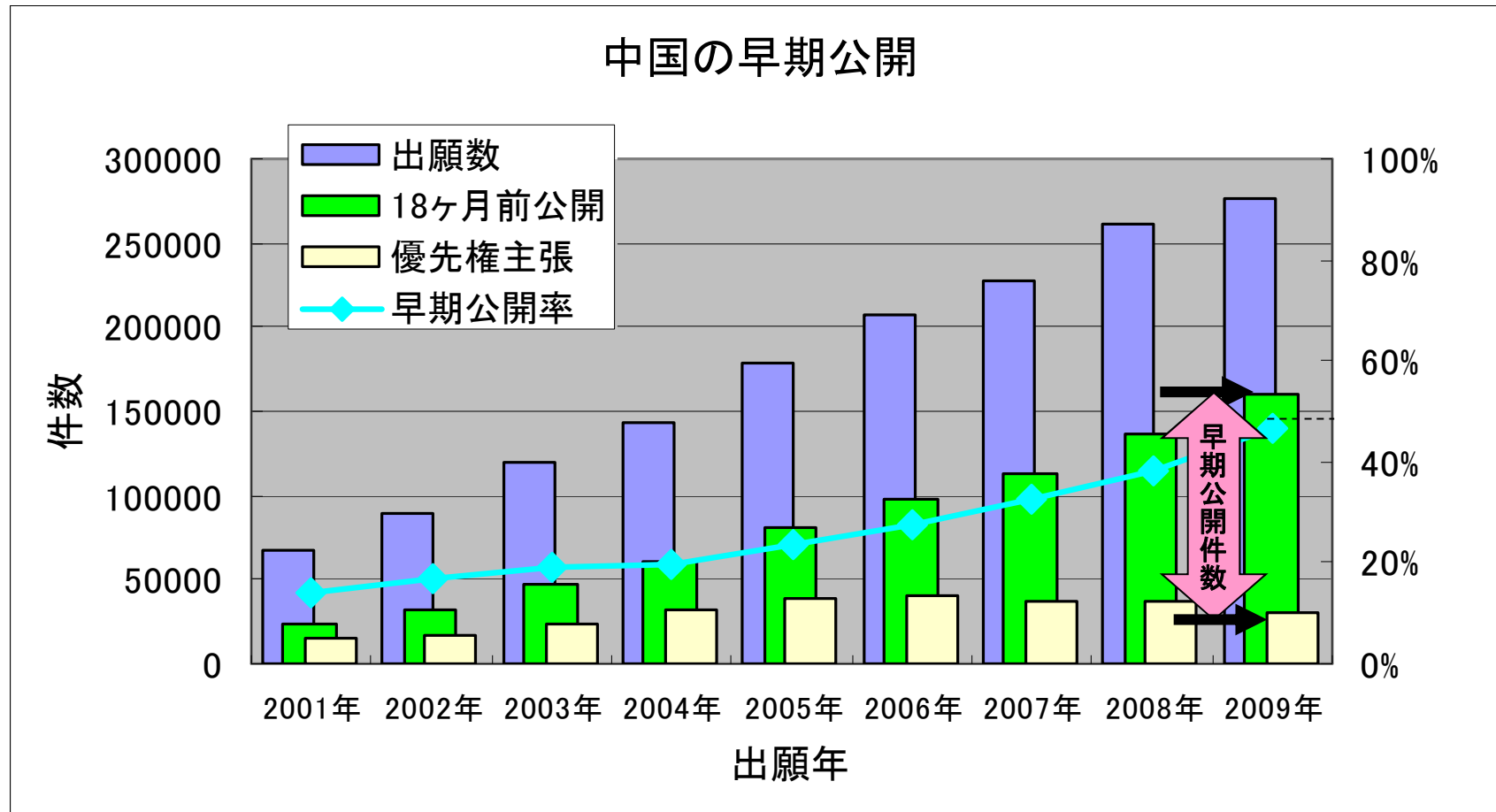
早期公開特許の実態



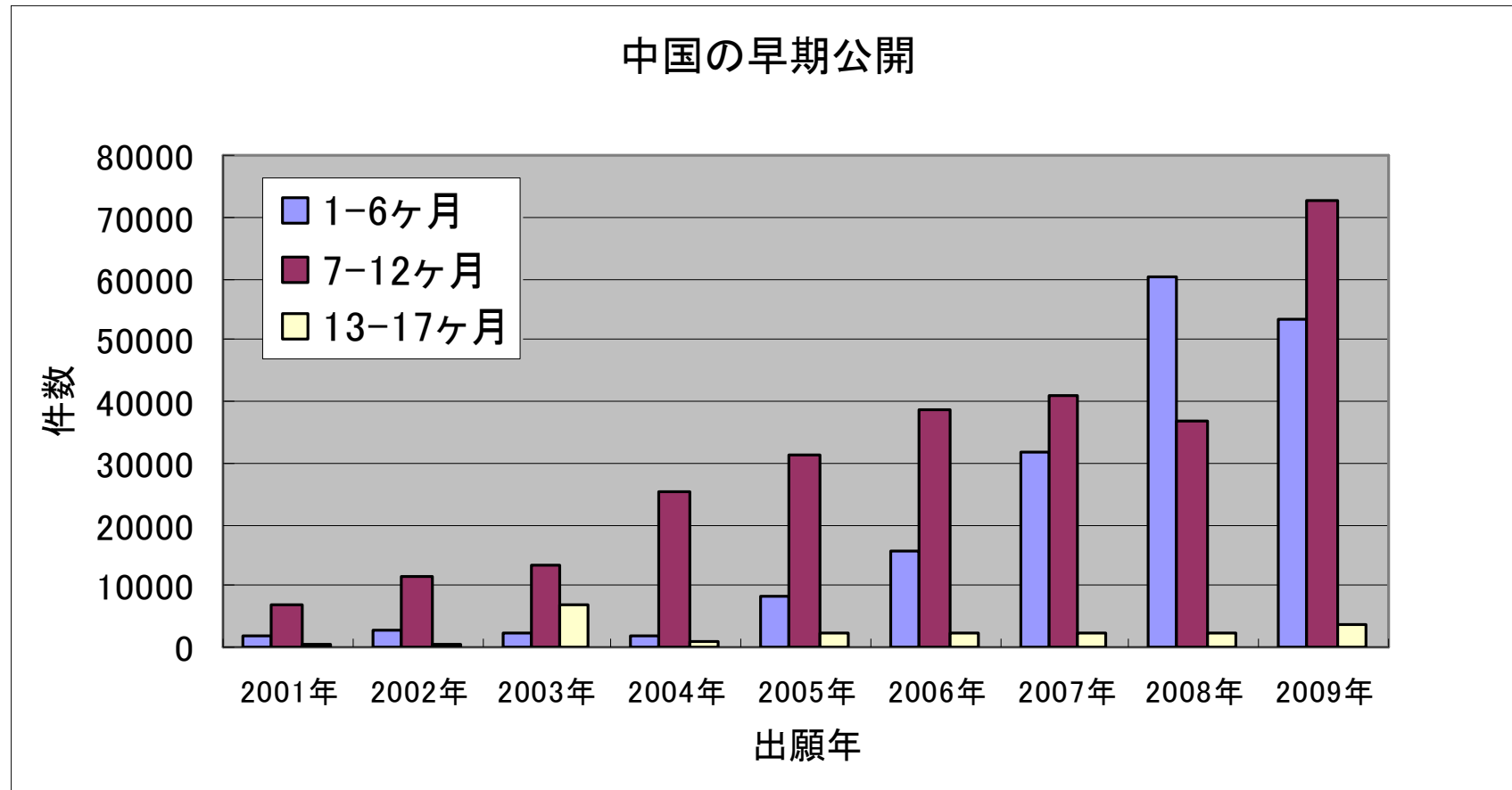
【早期公開特許】 特許制度に関係なく、出願日から18ヶ月経過する前に公開される特許

【使用DB】 中国:CNIPR, 韓国:KIPRIS, 台湾:TIPLO

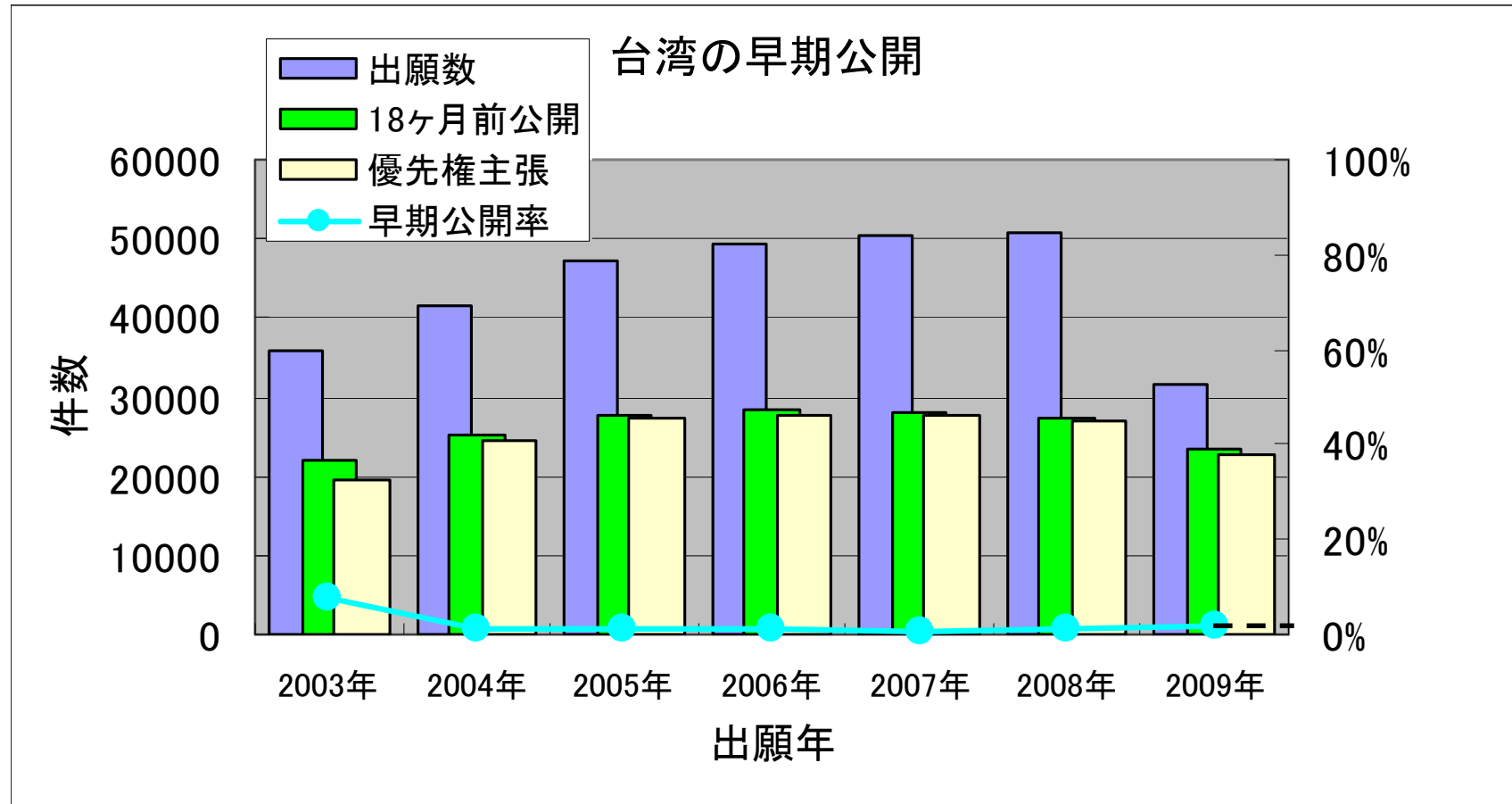
中国の早期公開状況①



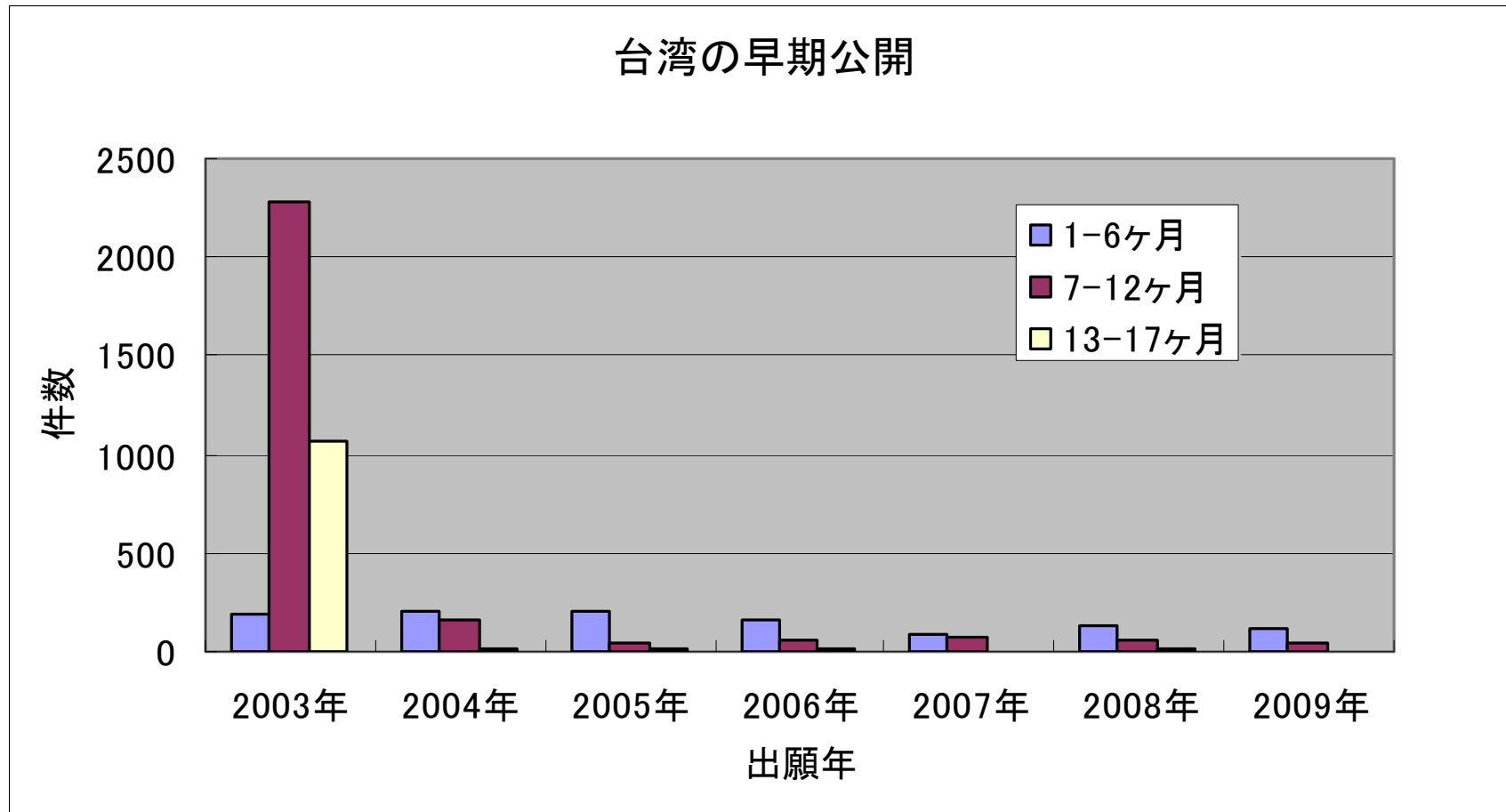
中国の早期公開状況②



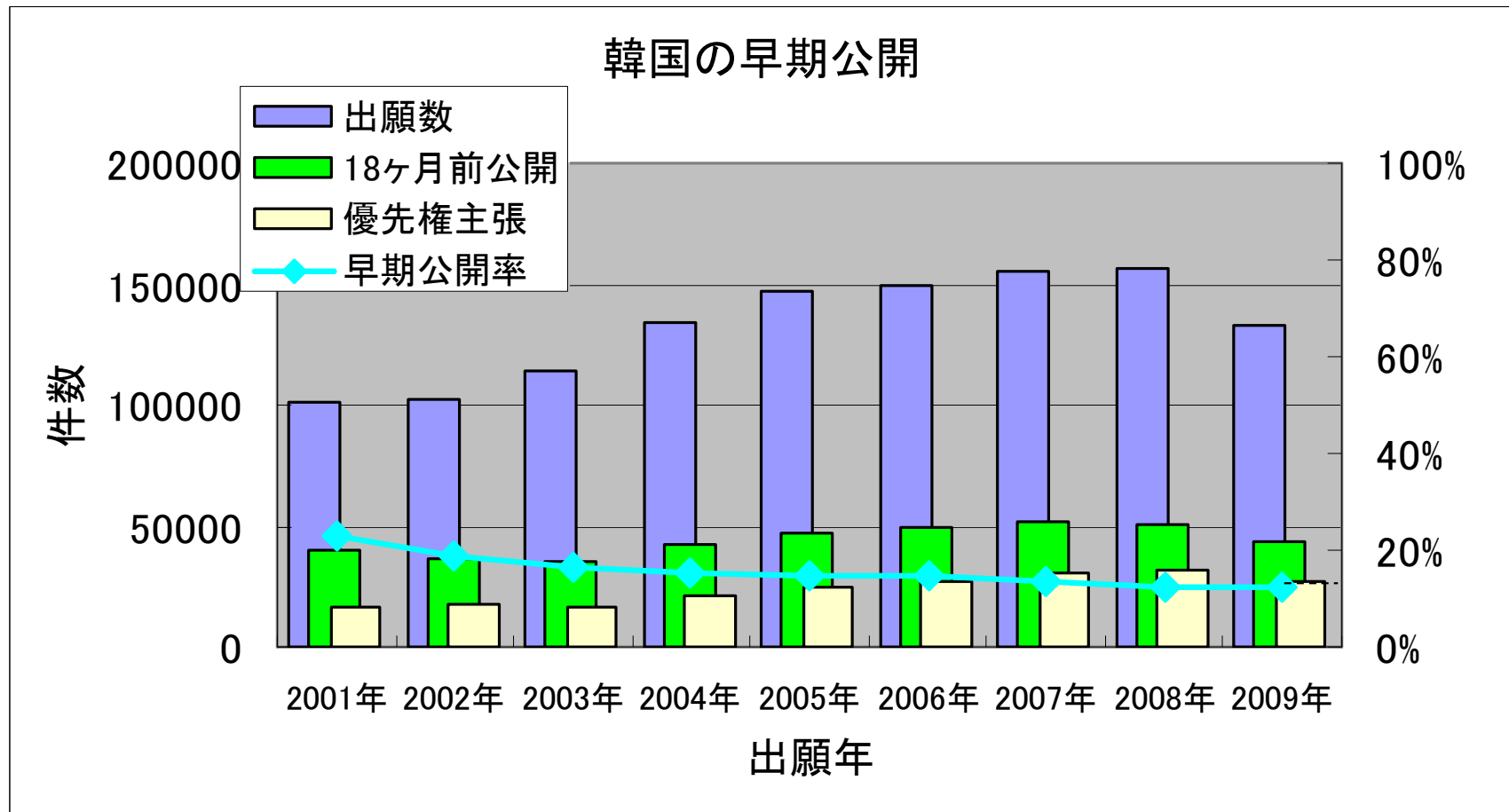
台湾の早期公開状況①



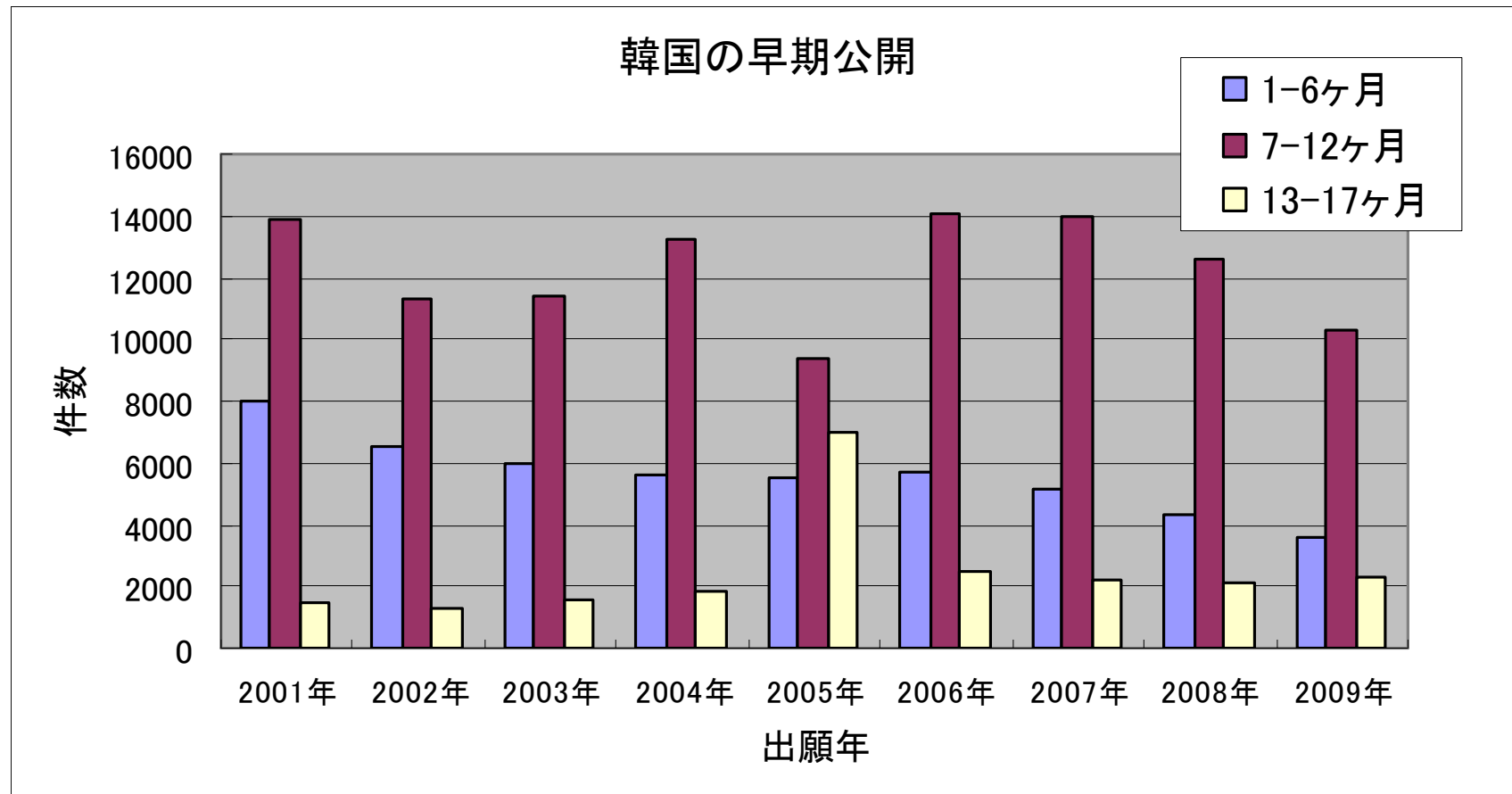
台湾の早期公開状況②



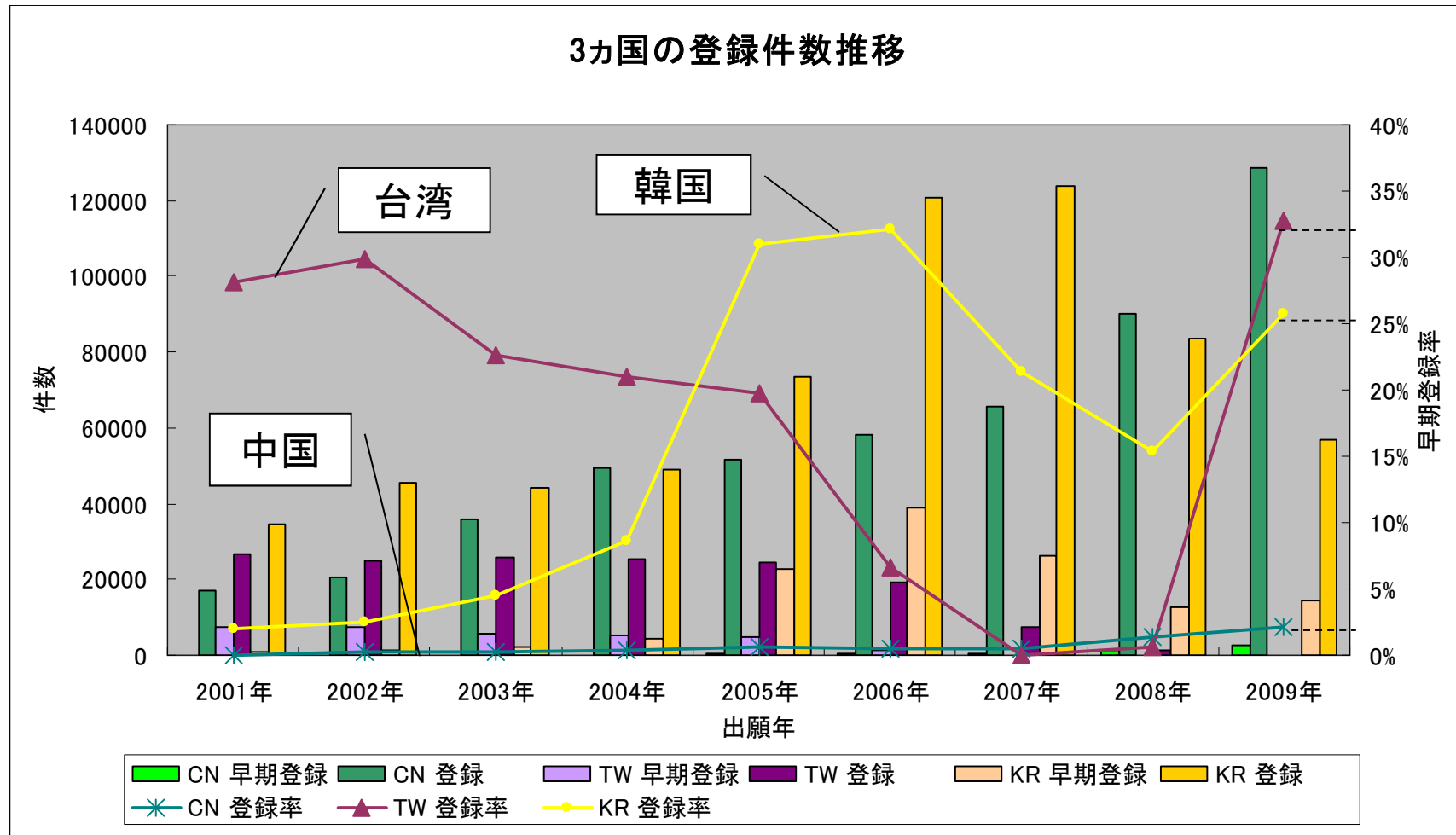
韓国 の 早期公開状況①



韓国の早期公開状況②

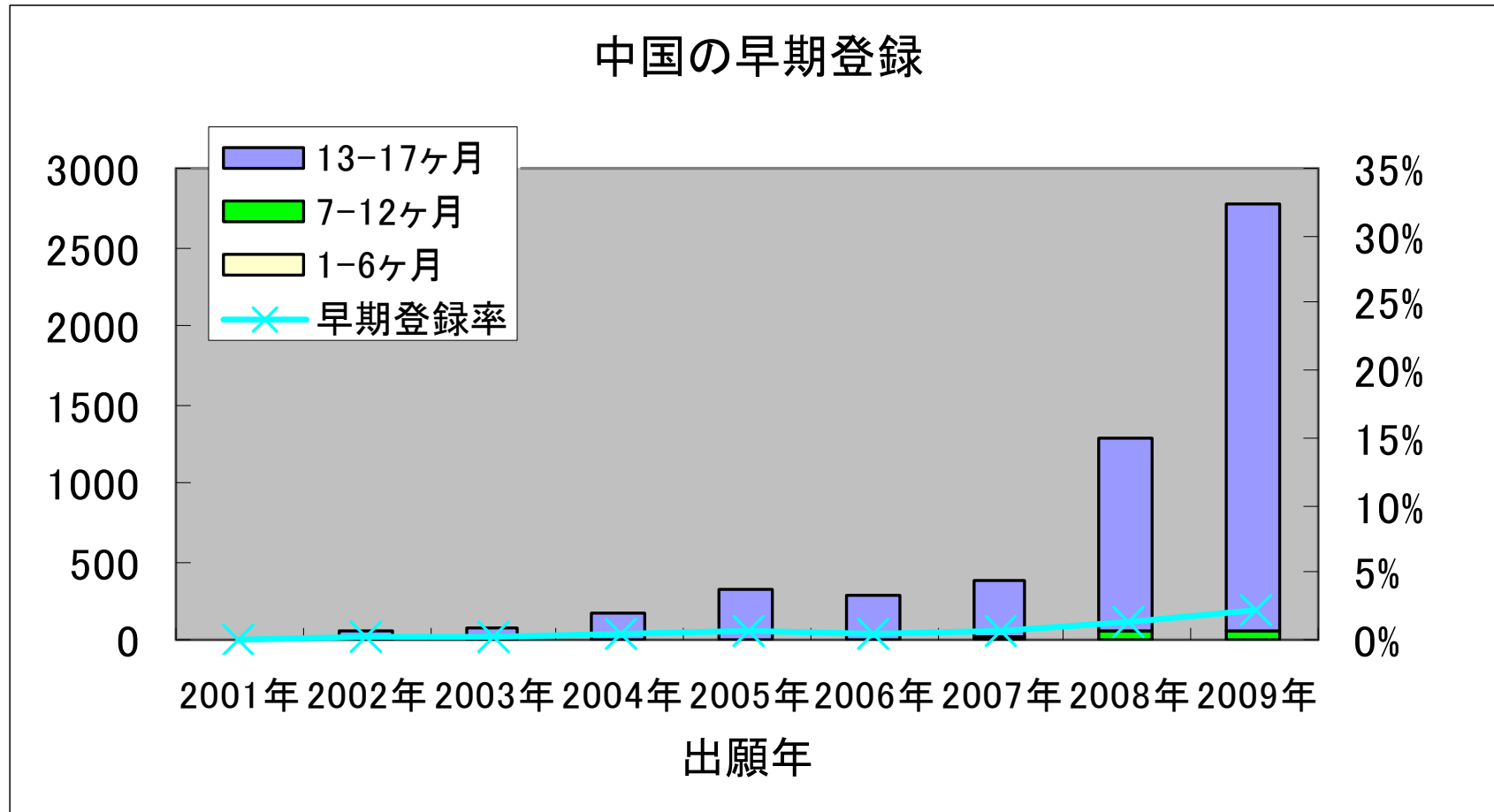


早期登録特許の実態

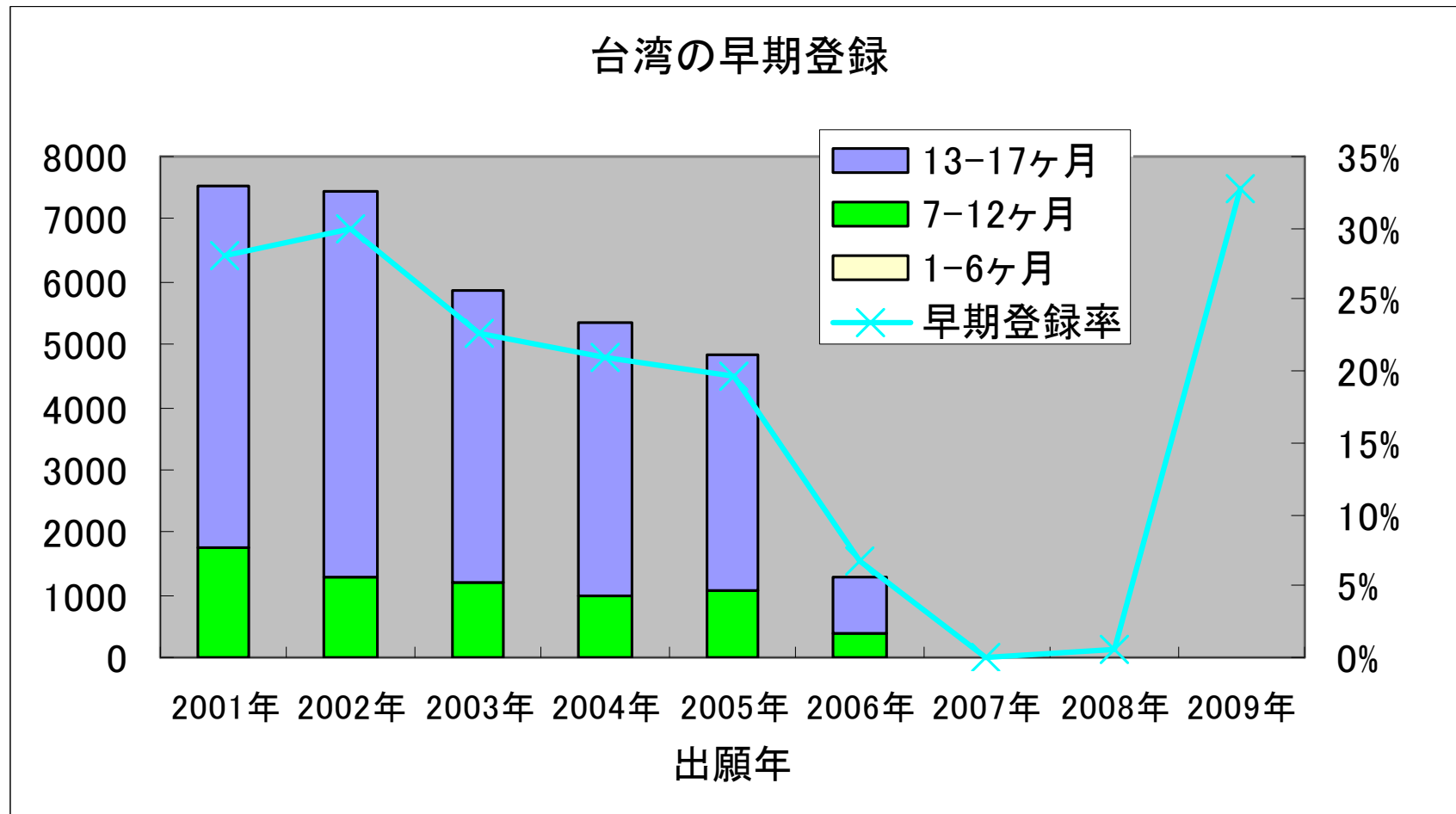


【早期登録特許】 早期審査制度に関係なく、出願日から18ヶ月未満に登録となる特許

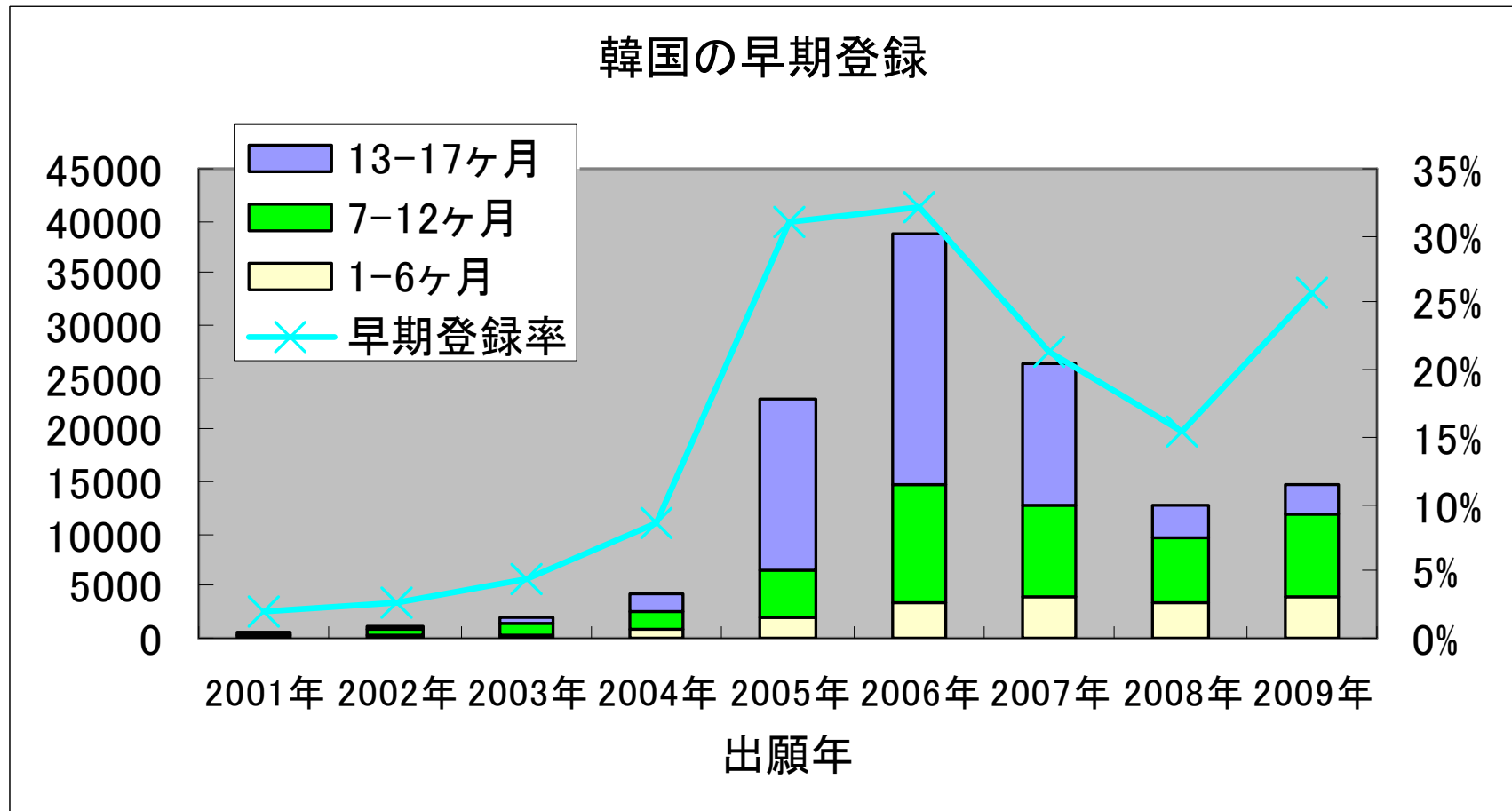
中国の早期登録状況



台湾の早期登録状況



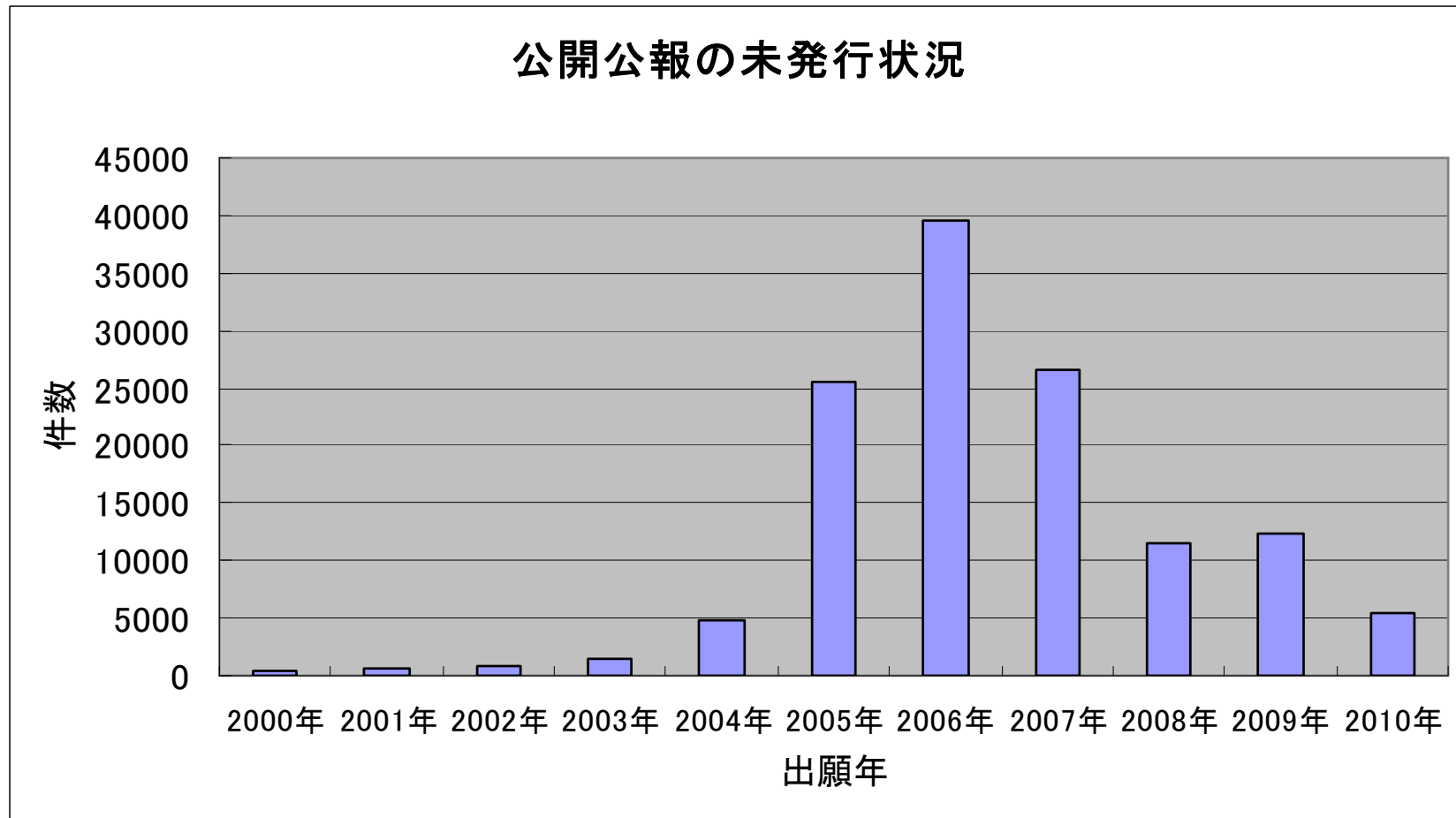
韓国 の 早期登録状況



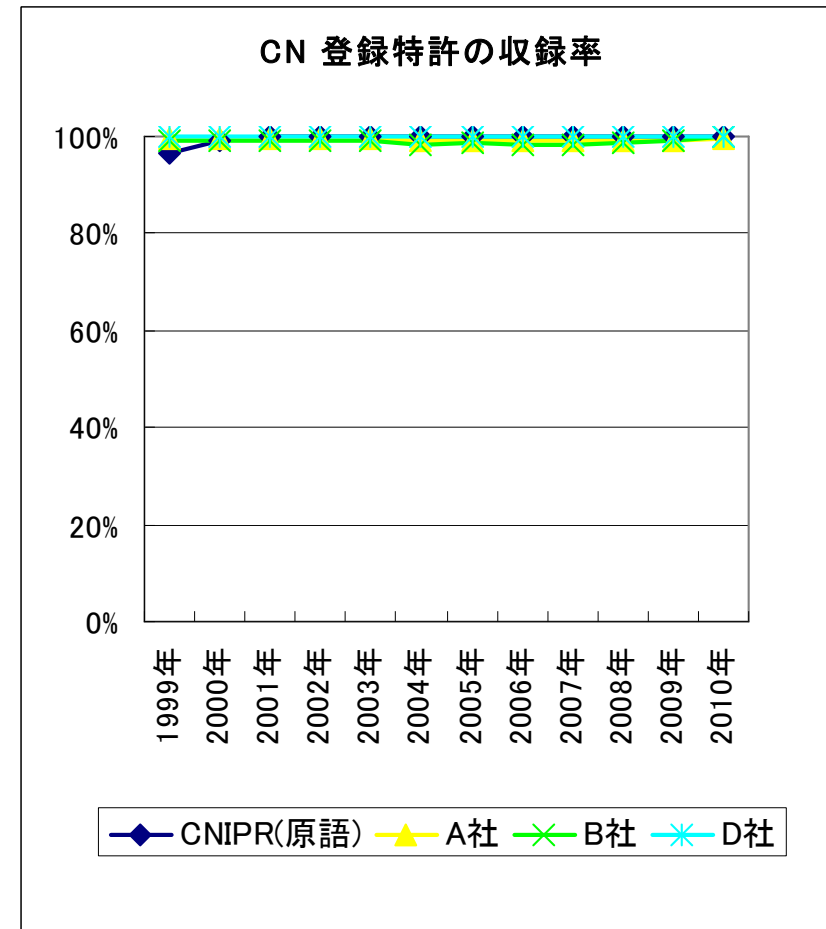
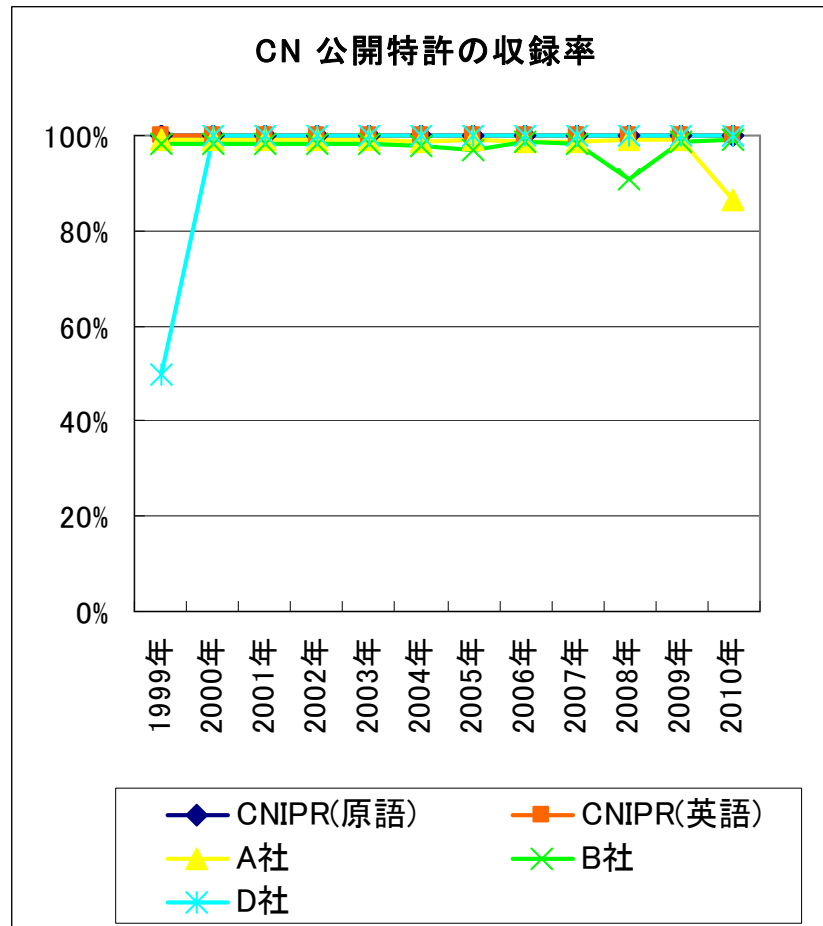
韓国登録の公開公報未発行数

【留意点】

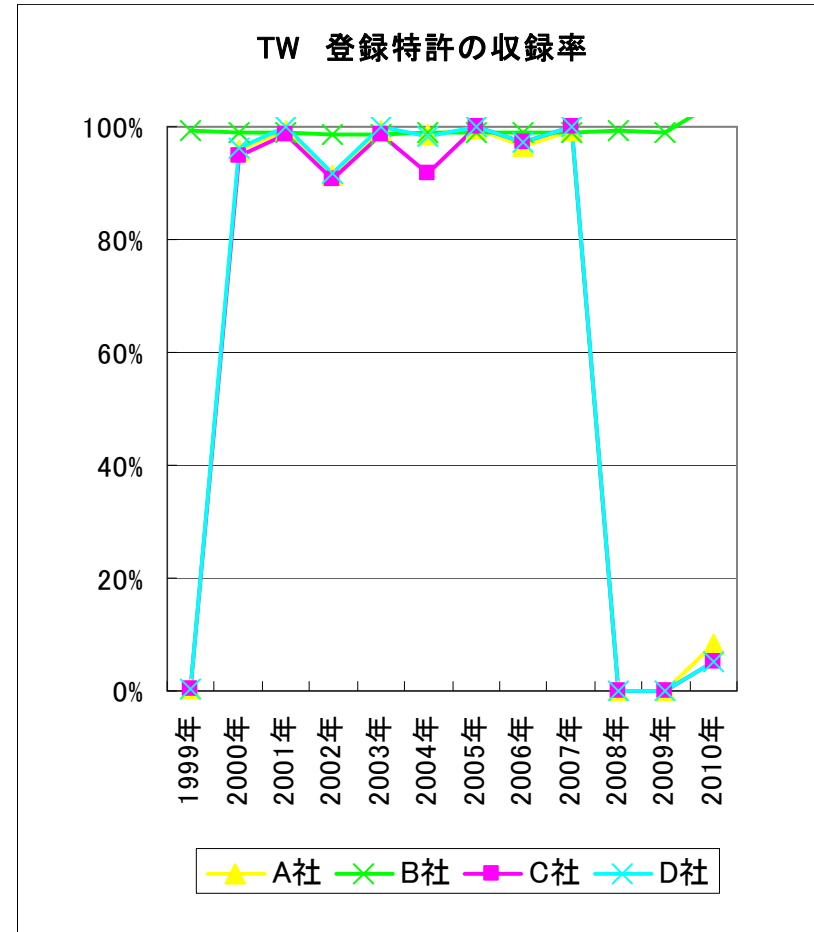
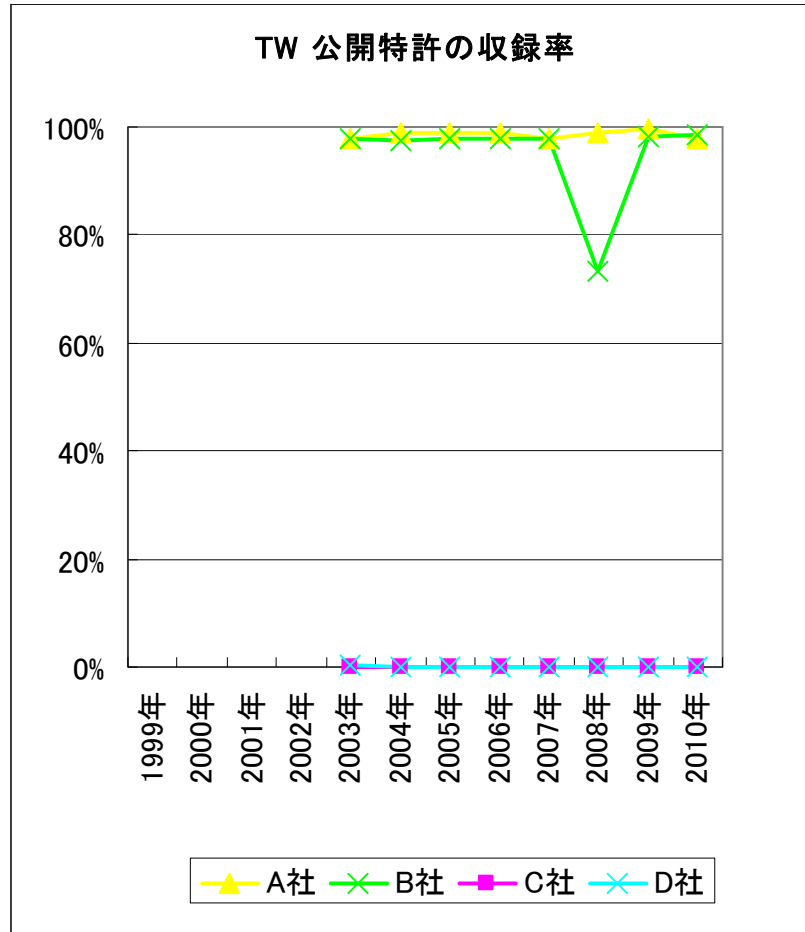
早期に登録された案件のうち、公開公報が発行されない場合がある。



中国特許の抄録収録率



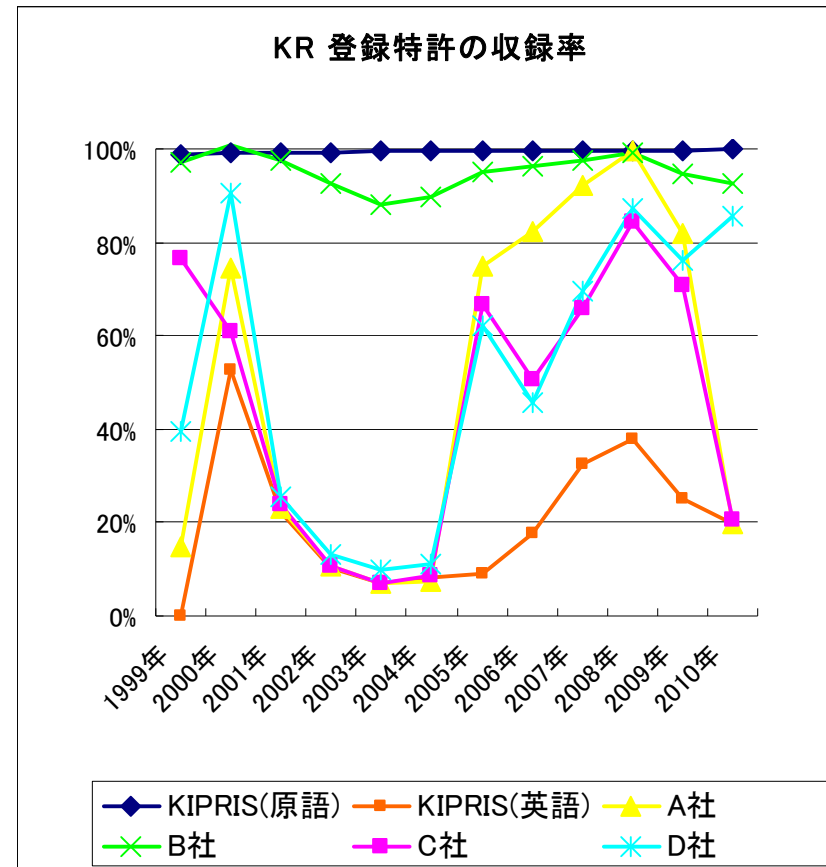
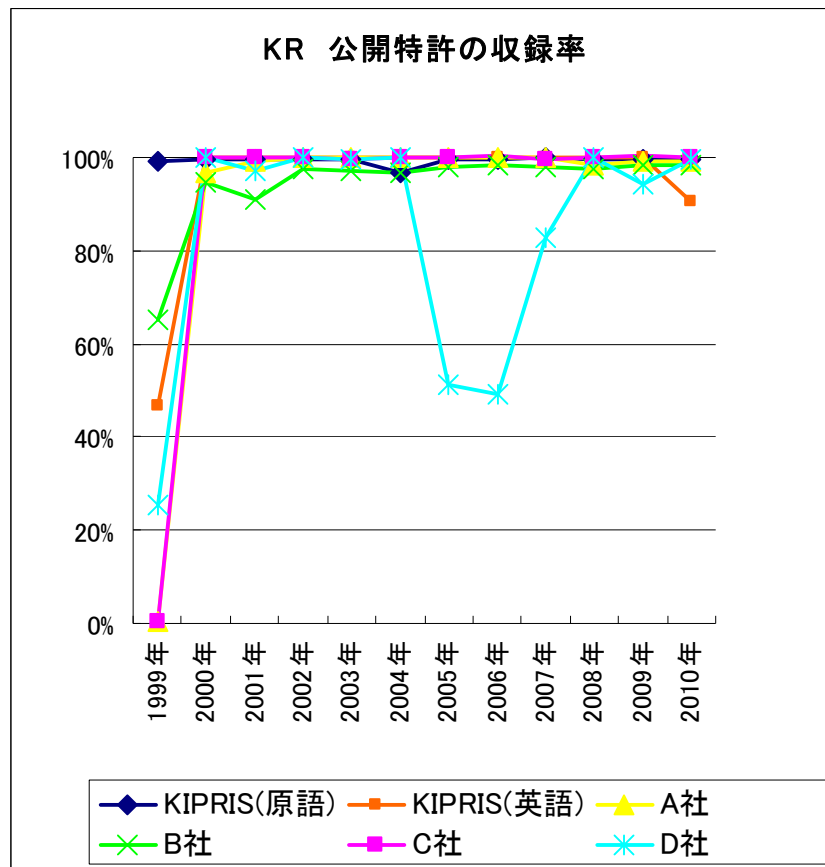
台湾特許の抄録収録率



韓国特許の抄録収録率

【留意点】

商用データベースの多くは登録の収録率が悪く、SDI検索では注意が必要です。



遅延公開の実態

		出願年							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
中国	4年目	5,061	7,929	13,126	10,391	11,187	8,910	12,541	6,920
	5年目	968	1,998	1,780	2,545	2,425	2,482	1,927	
	6年目	906	869	1,159	1,468	1,952	1,653		
	7年目	498	577	695	932	1,198			
	8年目	357	325	548	764				
	9年目	259	294	372					
	10年目	200	143						
台湾	4年目	24	61	45	76	78	86	107	78
	5年目	53	57	106	218	136	163	199	
	6年目	43	41	68	69	83	47		
	7年目	18	37	31	67	53			
	8年目	17	32	45	95				
	9年目	7	19	32					
	10年目	3	16						
韓国	4年目	11	10	30	22	37	17	124	11
	5年目	2	7	5	2	5	1	2	
	6年目	6	4	2	5	1	1		
	7年目	3	0	1	0	0			
	8年目	1	0	0					
	9年目	0	0	1					
	10年目	0	0						

出願から4年以上経っているものは、「分割出願」?

【遅延公開特許】出願から4年目以上経過して公開される特許

中国特許情報／遅延公開

遅い公開	AD(国際AD)	PD	出願⇒公開(日)	分割元出願番号	分割公開日	国際PD	PRD
1992出願 2009公開 CN200810177422.0	1 1992/7/11	2009/7/22	6220		92109770		
1995出願 2010公開 CN200710096070.1	4 1995/6/15	2010/3/3	5375		95193875.4	1997.06.11	
CN201010142285.4	1995/10/30	2010/7/28	5385	14年9ヶ月	95196147	1997.10.22	
CN201010173242.2	1995/10/20	2010/9/15	5444	14年11ヶ月	95196357	1997.11.05	
CN200910174917.2	1995/9/25	2010/9/15	5469	15年	95116752.9	1996.12.18	
1996出願 2010公開	13						
CN200910207728.0	1996/2/27	2010/3/31	5146		96190363.5	1998.02.25	
CN200910205220.7	1996/3/1	2010/6/30	5234	14年3ヶ月	96105797.1	1997.02.12	
CN200910151335.2	1996/4/26	2010/9/1	5241	14年4ヶ月	96194822.1	1998.07.15	
2004出願PCT 2010公開	6						
CN200480034752.4	2004/9/23	2010/1/13	1938	5年4ヶ月			
CN200480028714.8	2004/9/22	2010/1/20	1946	5年4ヶ月			
CN200480016783.7	2004/4/28	2010/3/24	2156	5年11ヶ月			
CN200480012303.X	2004/3/5	2010/5/5	2252	6年2ヶ月			
CN200480023759.6	2004/6/22	2010/8/4	2234	6年2ヶ月			
CN200480032288.5	2004/11/3	2010/9/29	2156	5年11ヶ月			

分割でもなく、出願から
5年以上たって公開

台湾特許情報／遅延公開

遅い公開	公開日	出願番号	出願日	特許庁申請案号	優先権
1998出願2010公開					
201044065	2010/12/16	99117228	1998/8/29	067114347	
2000出願2010公開					
201043639	2010/12/16	99128334	2000/9/18	095145663	美国 60/126,603 19990325
201041590	2010/12/16	99107267	2000/3/6	096103880	美国 09/206,601 19981207
					美国 60/111,255 19981207
201018459	2010/5/16	98145182	2000/8/25	094107594	美国 60/152,435 19990903
2001出願2010公開					
201036638	2010/10/16	99121901	2001/2/9	090102913	美国 60/181,608 20000210
201034872	2010/10/16	99108726	2001/5/29	094107365	
201030121	2010/8/16	99104101		093117294	日本 2000-399827 20001228
					日本 2001-261673 20010830
					日本 2001-261675 20010830
201022241	2010/6/16	99107488	2001/8/31	097127487	美国 60/229,396 20000631
					美国 60/277,641 20010312
201022242	2010/6/16	99107489	2001/8/31	097127487	美国 60/229,396 20000631
					美国 60/277,641 20010312
201022243	2010/6/16	99107492	2001/8/31	097127487	美国 60/229,396 20000631
					美国 60/277,641 20010312
201022244	2010/6/16	99107493	2001/8/31	097127487	美国 60/229,396 20000631
					美国 60/277,641 20010312
201022287	2010/6/16	98136652	2001/12/31	090133379	美国 60/259,227 20010103
					美国 60/284,547 20010419

分割

韓国特許情報／遅延公開

Unex. Pub. No.(Date)	Application No.(Date)	Right of Org. Application No.(Date)	Priority info. (Country/No./Date)		
			Country	No.	Date
2000年出願2006～2007年公開					
1020060086490 (20060801)	10-2000-0035835 (20000628)	10-1998-0007993 (1998.03.11)			
1020070108290 (20071109)	10-2000-0008723 (20000223)	10-1994-0701695 (1994.05.17)	영국(GB)	9124513.4	1991.11.19
2001年出願2006年公開					
1020060086492 (20060801)	10-2001-0007204 (20010214)	10-1998-0002550 (1998.01.30)	日本(JP)	1997-015384	1997.01.29
			日本(JP)	1997-322570	1997.11.25
1020060086494 (20060801)	10-2001-0040326 (20010706)	10-1998-0709669 (1998.11.28)	日本(JP)	1997-00079764	1997.03.31
			日本(JP)	1997-00099721	1997.03.31
1020060095869 (20060904)	10-2001-7013759 (20011026)	10-1998-0707354 (1998.09.17)	日本(JP)	1996-00061450	1996.03.18
			日本(JP)	1996-00163082	1996.06.24
			日本(JP)	1996-00232362	1996.09.02
			日本(JP)	1996-00243883	1996.09.13
1020060086493 (20060801)	10-2001-0013853 (20010706)	10-1997-0034016 (1997.07.21)			
2002年出願2007年公開					
1020080000688 (20080103)	10-2002-7015399 (20021115)	10-1996-0701143 (1996.03.07)	미국(US)	118,473	1993.09.08
1020070108291 (20071109)	10-2002-0064852 (20021023)	10-1995-0011648 (1995.05.12)	日本(JP)	1994-00098798	1994.05.12
			日本(JP)	1995-00104209	1995.04.27

分割

分割ではない例

1020060086491 (20060801)	10-2000-0037685 (20000703)		日本(JP)	99-188382	1997.07.02
1020060076791 (20060705)	10-2000-0040603 (20000714)		独逸(DE)	199336911	1999.07.17
1020070057288 (20070607)	10-2002-0035376 (20020624)				

まとめ

- ◆ 優先権主張を伴わない早期公開が、特に中国において増えて来ている
- ◆ 早期登録される案件が、特に韓国において増えている
- ◆ 中国ではPCT出願からの移行で公開が遅いものがある
- ◆ 商用英語データベースの中国特許収録のタイムラグはほぼ1～2ヶ月と良好
- ◆ 韓国登録特許の収録率が不十分な商用英語データベースもあり、場合によっては、KIPRISなどの原語データベースで補完する必要がある
- ◆ 東アジア各国の情報を漏れなく収集できるかについては極めて重要な問題であり、SDI検索には使用データベースの収録率を確認する必要がある

ご清聴ありがとうございました。

A11 早期公開・登録および遅延公開をめぐる東アジア各国の諸問題
